

中国科学院上海微系统与信息技术研究所文件

科沪微所字〔2026〕137 号

中国科学院上海微系统与信息技术研究所关于 印发《中国科学院上海微系统所公共技术 中心材料器件工艺与表征 平台收费标准》的通知

机关各部门、各实验室：

《中国科学院上海微系统与信息技术研究所公共技术中心材料器件工艺与表征平台收费标准》已经 2026 年 8 月 31 日所务会讨论通过，现印发给你们，自印发之日起施行。原《中国科学院上海微系统所公共技术中心材料器件工艺与表征平台收费标准》（科沪微所字〔2023〕207 号）同时废止。

中国科学院上海微系统与信息技术研究所
2026 年 9 月 2 日

中国科学院上海微系统与信息技术研究所公共技术中心
材料器件工艺与表征平台收费标准

类别	设备名称	规格型号	项目	机时费		代工费	耗材费	备注
				所内	所外			
湿法清洗	通风橱	定制	清洗腐蚀剥离等	200 元/次	250 元/次	150 元/30 分钟		按有机试剂每 500ml、无机试剂每 100ml 计 1 次
黄光区	自动匀胶台	RCD 8	匀胶	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟	150 元/30 分钟	50 元/片	
	自动匀胶台	SM-150	匀胶	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	通风橱	定制	显影	100 元/30 分钟	120 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	接触式光刻机	MA6/BA6	光刻	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟	150 元/30 分钟		掩模版自备
	接触式光刻机	MA8	光刻	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟	150 元/30 分钟		掩模版自备
	高精度光掩膜制备系统	Miscan200	直写光刻	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
			制版	700 元/片@3 寸 800 元/片@4 寸 1000 元/片@5 寸 1500 元/片@7 寸 2500 元/片@9 寸	700 元/片@3 寸 800 元/片@4 寸 1000 元/片@5 寸 2000 元/片@7 寸 3000 元/片@9 寸			最小线宽 $\leq 2\mu\text{m}$ 加收 50%, 最小线宽 $\leq 0.8\mu\text{m}$ 需要定制, 价格另议
	激光直写光刻系统	Picomaster 200	直写光刻	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟	150 元/30 分钟		版图设计费另议
	无掩膜直写光刻系统	Dwl66+	直写光刻	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
	紫外纳米光刻设备	UVNANO-100-A	投影曝光	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟	150 元/30 分钟		Mask 需定制, 费用另算
	纳米图形电子束直写系统	Voyager max	电子束曝光	800 元/30 分钟	1000 元/30 分钟			
	电子束曝光系统	Eline SEM	电子束曝光	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟			

			光					
	晶圆对准键合系统	XB 8	晶圆键合	500 元/30 分钟	600 元/30 分钟	150 元/30 分钟		
薄膜区	电子束蒸发台	Qbox450	电子束蒸发镀膜	125 元/30 分钟	150 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au: 25/nm Pt、Pd: 15 元/10nm 其他: 10 元/10nm	
	高真空复合电子束蒸镀系统	E550	电子束蒸发镀膜	300 元/30 分钟	360 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au: 40/nm Pt、Pd: 35 元/10nm 其他: 20 元/10nm	
	高真空金属膜沉积系统	PVD750	磁控溅射镀膜	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au, Pt: 8 元/nm 其他: 10 元/10nm	
	多层金属膜溅射沉积系统	SP-LC8-A04	磁控溅射镀膜	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟	150 元/30 分钟	Au, Pt: 8 元/nm 其他: 10 元/10nm	
	感应耦合等离子化学气相沉积	SENTECH SI 500D	介质膜沉积	400 元/30 分钟	480 元/30 分钟			
刻蚀区	化合物半导体精细刻蚀设备	SENTECH SI 591	介质膜与体材料刻蚀	300 元/ 30 分钟	360 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
	等离子去胶刻蚀系	SENTECH SI 500	ICP 刻蚀	400 元/ 30 分钟	450 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		

	统		去胶					
	感应耦合等离子刻蚀设备（02）	鲁汶仪器 HAASRODE-E200	ICP 刻蚀	400 元/ 30 分钟	480 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
	离子束刻蚀系统	鲁汶仪器 HAASRODE-I200	离子束刻蚀	500 元/ 30 分钟	600 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
工艺表征 与辅助	快速退火炉	AW410	快速热退火	150 元/ 30 分钟	180 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
	共聚焦显微镜	Zeiss LSM900	共聚焦表征	200 元/30 分钟	240 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
	桌面型扫描电镜	Hitachi T1000	快速 SEM	200 元/30 分钟	240 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
	半导体参数分析仪	Keysight B1500	IV, CV	100 元/30 分钟	120 元/ 30 分钟	150 元/30 分钟		
	电镀	/	电镀 Au	100 元/片	150 元/片	150 元/30 分钟	4 寸 500 元/ μm	
	台阶仪	BRUKER DEKTAK XT		机时免费		150 元/30 分钟		
	金相显微镜	NikonLV150		机时免费		150 元/30 分钟		
	金相显微镜	ZeissAxioLab5		机时免费		150 元/30 分钟		
	超声波扫描显微镜	SAM 402	超声无损测试	200 元/30 分钟	250 元/30 分钟	100 元/30 分钟		
	纳米级原位拉曼表征系统	inVia/icon	AFM：高分辨三维形貌成像、相位图等	400 元/小时	500 元/小时			
			SCM 、 KPFM 、	600 元/小时	650 元/小时			

			EFM 、 PFM 、 MFM 、 CAFM					
			拉曼测试 点/面扫描	400 元/小时	450 元/小时			
	热场发射扫描电子 显微镜	Supra 55	SEM	300 元/小时	500 元/小时	100 元/小时		
			EBL/EBS D	600 元/小时	800 元/小时	200 元/小时	所内能谱 40 元/次， 所外能谱 60 元/次	EDS 费用不含 SEM 机时 费，需在 SEM 使用费基础 上叠加计收。
	聚焦离子束显微分 析仪	Helios 5 Laser PFIB	高精度与 微纳加工	1000 元/小时	1200 元/小时			
			大尺寸截 面加工和 表征	1300 元/小时	1500 元/小时			
			TEM 制样	3000 元/样	3500 元/样			特殊材料和样品制样价格 面议
	聚焦离子束刻蚀系 统	VELION S	FIB 加工	1000 元/小时	1200 元/小时			
	场发射透射电子显 微镜	Talos F200X G2	原子形貌， EDS ， STEM	800 元/小时	900 元/小时			
	微光红外显微仪	ELITE	失效分析	600 元/小时	800 元/小时			
	激光光束诱发阻抗 变化测试显微仪	MERIDIAN S	失效分析	600 元/小时	800 元/小时			

	减薄抛光系统	LP70	减薄抛光	400 元/小时	500 元/小时	200 元/小时		
	高精度扫描探针显微镜	Dimension Icon6	AFM	400 元/小时	450 元/小时			
			CM 、 KPFM 、 EFM 、 PFM 、 MFM 、 CAFM	600 元/小时	650 元/小时			
	激光电路制版机	ProtoLaser U3	双面覆铜 制板, 激光 划片	250 元/30 分钟	300 元/30 分钟			双面覆铜版材料用户自备

